



## Microwave Diamond Deposition Processor

## マイクロ波ダイヤモンド成膜装置

高出力（最大5kW）のマイクロ波電源および自動整合器（4Eチューナ）により、安定な高密度プラズマを発生させ、高品質ダイヤモンドを高速合成できます。

## 形式: MDD-2016

## 【特長】

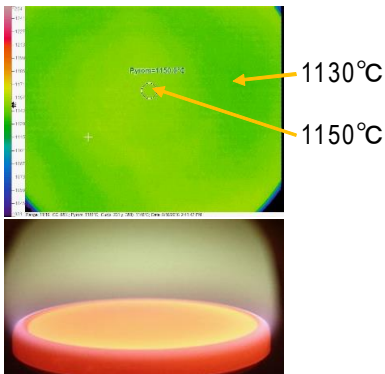
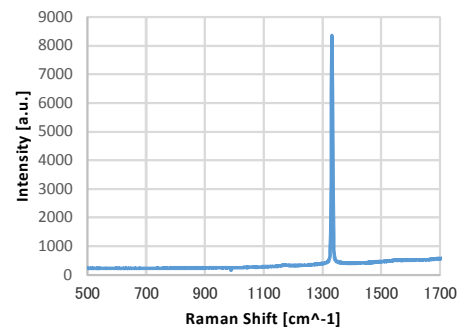
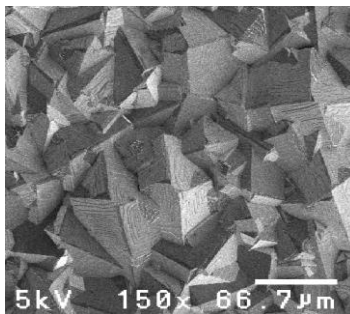
弊社独自のプラズマ制御機能により、プラズマ点灯状態で基板上的プラズマ分布を制御できます。

## 【仕様】

主な仕様および機能	
MW電源	2450MHz, 最大出力 5kW (日本高周波製)
整合方法	4Eチューナによる自動整合 (日本高周波製)
圧力制御	自動圧力制御
反応ガス	メタン, 水素, 酸素 (増設可能)
形状	1500mm (W) × 900mm (D) × 2000mm (H)
成膜範囲	直径2インチ
成膜速度	20 $\mu$ m/h 工具グレード, 4 $\mu$ m/h 光学グレード



装置外観

φ2インチ成膜中の  
プラズマと温度イメージ

成膜したダイヤモンド膜のSEM像とRAMANスペクトル

- ◆マイクロ波電源はマグネトロン発振（連続波、パルス波、高安定スペクトル）およびソリッドステート発振など、弊社電源ラインナップからお選び頂けます。
- ◆現在お使いの装置の電源アップグレード、その他の改良、また、試験成膜、受託成膜についてもお気軽にお問合せ下さい。

※記載内容は、改良その他により予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。



日本高周波株式会社